

IPLux (アイピー・ルクス)

TOPICS

1. ご挨拶
2. 法改正情報
3. iPhone XのFace ID特許
4. デザインと知財
5. この特許は有効でしょうか？

◇ ご挨拶

あけましておめでとうございます。

皆様におかれましては、本年益々のご健勝でご盛栄されますよう、お祈り申し上げます。

私どもTeam Luxからお届けしているニュースレター『IPLux』は、本年、3年目に入ることとなりました。ひとえに、皆様のお陰と感謝申し上げます。気持ちを新たに邁進する所存ですので、本年もよろしく願いいたします。

昨年、日本経済は、多くの企業様が過去最高益を更新されるなど、『ものづくり日本』の復活が感じられました。言い古されてはおりますが、日本は天然資源に恵まれていないものの、人が生み出す知的財産は高品質で豊富です。この財産を大切に育て、将来に引き継ぎたいと思います。我々も微力ながらそのお手伝いをさせていただきたいと思っております。



◇ 法改正情報

毎年のように改正される特許法をはじめとする産業財産権法ですが、近くまた改正が予定されておりますので、改正法情報をお知らせいたします。

特許庁特許制度小委員会からの発表によれば、次回の改正項目として以下の項目が検討されております。

1. 証拠収集手続きの強化
2. グレースピリオドの拡充
3. 中小企業特許料一律半額
4. 判定制度、料金納付制度

このうち、特に皆様に関係が深い2及び3について説明いたします。

① グレースピリオドの拡充

出願前に論文や学会報告、展示会などで公表されている発明は本来新規性がないものとして権利化できませんが、例外として公表から6ヶ月以内に出願すればこの公表では新規性を失わないとする制度です。

現在はグレースピリオドの期間として6カ月以内となっておりますが、これを12カ月に延長してより厚い救済措置を目指すことを予定しています。

② 中小企業特許料一律半額化

現在でも、中小企業の出願に対する審査請求料や特許料については減額制度がありますが、手続きが煩雑ということもあり、活用促進が望まれています。今回、手続きを簡素化し、一律に半額、という改正を予定しています。

現在、中小企業の特許出願が全出願に占める割合は15%程度にとどまっていますが、この割合を引き上げ、中小企業の特許の活用を促進することを目指しています。

一方、大企業などの審査請求料については値上げも検討されているので、この点には今後注視する必要があります。

この改正法について、特許庁は次期通常国会での通過及び2019年施行を目指しています。

◇ iPhone XのFace ID特許

AppleがiPhone Xに新たに採用した顔認証機能『Face ID』ユーザーが見つめるとロックを解除する機能ですが、この技術にどんな特許が使われているのか、調べてみました。

3万点のドットを赤外線顔に投影・撮像して深度マップを作り、ユーザーを認証します(US8064685, US8326001等)。

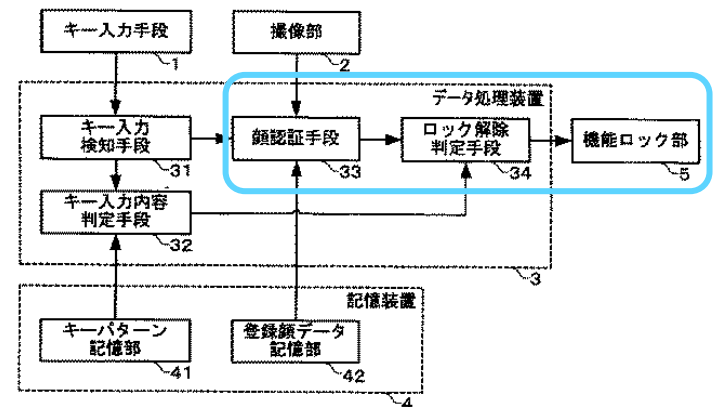
さらに機械学習によって精度を高めています(US8320636, US8385638, US9495583等)。

そして、最も基本的な、顔認証によるロック解除技術は、“Locking and unlocking a mobile device using Facial Recognition”という文字通りの名称の特許があります(US8994499等)。

これらは、特許調査によって抽出したもので、Apple社に確認をとったものではありません。

特許調査の過程で、興味深い日本特許出願を見つけましたので、ご紹介します。

「顔認証によるロック解除」を行う、携帯電話(ガラ携)の特許(WO2007/119818; 発明者: 鈴木哲明氏、出願人: 日本電気)です。



この特許の最初の出願は2006年4月です。Apple社のUS8994499の2011年3月よりも、5年早く日本人発明者が同じような着想の発明をしていたこととなります。

「もしも、そのままスマホの研究開発に進んでいたら……」などと考えてしまいます。

◇ デザインと知財

特許庁は、知財に関する資料をホームページなどで提供しています。特許庁の資料は、初心者向けから実務者向け、外国の知財担当者向けまで、多岐に渡っています。最近、『知財教材「デザイナーが身につけておくべき知財の基本」』という興味深い資料がありましたので、ご紹介いたします。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/chizai_kyozai-designer-kihon.htm

ホームページによれば、本教材はデザイナーやデザインを学ぶ学生向けのものであり、シラバスと講義用資料で構成されています。学習する時間などに応じて編集、利用することが可能です。講義用資料は15個のパートに分かれています。すべてを順番に学習しなくてもよく、関心に応じてピックアップすることもできます。

スペースの都合上内容のご紹介はできませんが、一部拝読したところ、学生を対象として

いることもあり、デザインの「仕事、マネジメント」という部分にもスポットを当てている点は新しいと感じました。特許庁はあくまで知的財産に係る権利の取得手続などを管轄する機関であり、具体的にその知的財産権をどのように活用していくかの「仕事、マネジメント」は個々の企業などに任されているからです。資料としての汎用性を高めるために、学生向けに「お仕事紹介」の意味合いも含めているのかもしれない。

「デザインが良ければ売れる」というわけではありません。しかし、SNSの発展という後押しもあり、デザインが良ければその商品が人の目に触れる機会が増えることは間違いなくでしょう。デザインだけが独り歩きしないように、デザインを知的財産権で保護しておくことは大切です。そのような意識を持つだけでも、デザイナーや学生の皆さんの視点は変わるはずです。

◇ この特許は有効でしょうか？

先行技術調査をしている中で、興味深い下記特許を発見しました。

特許第6099932号

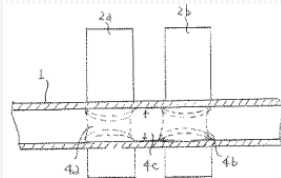
出願日：平成24年11月2日

発明の名称：

流体輸送管路の凍結工法

発明者：大久保 太陽

出願人：(株)大勇フリーズ



公知発明

特開2009-127206

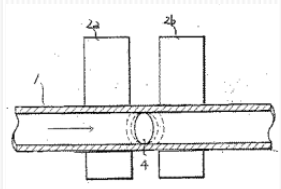
公開日：平成21年6月11日

発明の名称：

流体輸送管路の凍結工法

発明者：大久保 明勇

出願人：(株)大勇フリーズ



これらは、水道管内の水を凍結させて止水する技術であって、内面が平滑な水道管であっても確実に止水するため、冷凍装置を二カ所に設けて凍結させるという技術思想において同一です。図面において横長中空部品が水道管、所定の間隔を置いて配置されている縦長の装置が冷凍装置です。

特許発明は、公知発明が公開された後の出願です。公知発明は二つの冷凍装置の向かい合った端部から氷が成長し、中央が膨らんだ凸レンズ型の氷が生成されることによって強固な栓になる旨の説明があります。特許発明は、各冷凍装置部分から凍結し、冷凍装置の間に水が残り、残水が凍結することにより、左右の凍結部に凍結に伴う膨張が制限されるため、周方向に膨張し、水道管内面と氷との圧接が増すことにより強固な栓が生成される旨の説明があり、この作用の記載が先行技術には存在しないと反論したことにより、特許されています。公知発明は、二つの冷凍装置を用いる引用例によって進歩性なしとして拒絶されています。筆者は公知発明の作用の説明に疑問があります。そもそも、冷凍装置の端部から氷は成長しないと考えます。公知発明も、特許発明と同一の論理により強固な栓が形成されたのではないのでしょうか？そうすると、公知発明は特許発明を内在していたと考えるのが妥当です。産業の発達を目的とする特許制度に照らし、そのような発明に対し、単に記載がないからとの理由で特許するのはいかがなものでしょうか。そのように考えるのは私のみでしょうか？

お問い合わせ先

英究特許事務所

弁理士 小島 浩嗣

URL: <http://www.aq-patent.com>

「aq-patent」で検索ください。

e-mail: kojima@aq-patent.com

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-16-6

TEL: 03(6869)2686

TEL/FAX(所沢サイト): 04(2935)3214

技術者として培った、半導体のプロセス～回路～システムの技術力を使って、サポートさせていただきます。

・特許調査／分析

・特許調査セミナー

「短時間で確実にみつける検索手法」

「特許マップは自分で作ろう」

など

・発明者面談に基づき明細書と図面を準備
(発明者原稿をご用意いただく必要なし)

※本ニュースレターは、有志の弁理士グループ『Team Lux(チーム・ルクス)』(本谷、井澤、藁科、小島)が旬の知財情報の中から、企業の皆さまの知財業務に役立つ情報をピックアップして提供させていただいております。尚、内容についてのご質問、お問い合わせは、『Team Lux(チーム・ルクス)』のメンバーである配布責任者までお願いいたします。

※ニュースレター『IPLux(アイピー・ルクス)』の名称について

「Lux(ルクス)」はラテン語で「光」の意味です。本ニュースレターが、皆様にとって知的財産(IP; Intellectual Property)に関する一筋の道、一筋の光となるように命名しました。末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。